

磁控溅射机公司 磁控溅射机 沈阳鹏程真空技术公司

产品名称	磁控溅射机公司 磁控溅射机 沈阳鹏程真空技术公司
公司名称	沈阳鹏程真空技术有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沈阳市沈河区凌云街35号
联系电话	13898863716

产品详情

磁控溅射——溅射技术介绍

直流溅射法：直流溅射法要求靶材能够将离子轰击过程中得到的正电荷传递给与其紧密接触的阴极，从而该方法只能溅射导体材料，不适于绝缘材料。因为轰击绝缘靶材时，表面的离子电荷无法中和，这将导致靶面电位升高，外加电压几乎都加在靶上，两极间的离子加速与电离的机会将变小，甚至不能电离，导致不能连续放电甚至放电停止，溅射停止。故对于绝缘靶材或导电性很差的非金属靶材，磁控溅射机厂家，须用射频溅射法（RF）。

溅射过程中涉及到复杂的散射过程和多种能量传递过程：入射粒子与靶材原子发生弹性碰撞，磁控溅射机公司，入射粒子的一部分动能会传给靶材原子；某些靶材原子的动能超过由其周围存在的其它原子所形成的势垒（对于金属是5-10 eV），从而从晶格点阵中被碰撞出来，产生离位原子；这些离位原子进一步和附近的原子依次反复碰撞，产生碰撞级联；当这种碰撞级联到达靶材表面时，如果靠近靶材表面的原子的动能大于表面结合能（对于金属是1-6eV），这些原子就会从靶材表面脱离从而进入真空。

如需了解更多磁控溅射产品的相关信息，欢迎关注沈阳鹏程真空技术有限责任公司网站或拨打图片上的热点电话，我司会为您提供专业、周到的服务。

磁控方箱生产线介绍

用于纳米级单层及多层功能膜、硬质膜、金属膜、半导体膜、介质膜等新型薄膜材料的制备。广泛应用于大专院校、科研院所的薄膜材料科研与小批量制备。

主要由真空室系统溅射室、靶及电源系统、样品台系统、真空抽气及测量系统、气路系统、电控系统、计算机控制系统及辅助系统等组成。

技术指标：极限真空度 6.7×10^{-5} Pa，系统漏率： 1×10^{-7} PaL/S；恢复真空时间：40分钟可达 6.6×10^{-6} Pa（短时间暴露大气并充干燥氮气后开始抽气）

镀膜方式：磁控靶为直靶，向下溅射成膜；样品基片：负偏压 -200V

样品转盘：在基片传输线上连续可调可控，磁控溅射机，在真空下可轮流任意靶位互换工作。样品转盘由伺服电机驱动，计算机控制其水平传递；

可选分子泵组或者低温泵组合涡旋干泵抽气系统，计算机控制系统的功能：对位移和样品公转速度随时间的变化做实时采集，对位移误差进行计算，以曲线和数值显示。样品公转速度对位移曲线可在线性和对数标度两种显示之间切换，可实现换位定点镀膜。

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多磁控溅射产品的知识，欢迎拨打图片上的热线联系我们。

线列式磁控生产线

沈阳鹏程真空技术有限责任公司专业生产、销售磁控溅射产品，我们为您分析该产品的以下信息。

采用先进的in-line产线结构，Twin-Mag孪生阴极磁控溅射技术，并配以全自动控制系统、先进的真空系统，磁控溅射机价格，可在玻璃衬底上镀制SiO₂、ITO、AZO、Al、Ni、Ti等各类绝缘介质薄膜、金属或合金薄膜，并可连续溅镀多种不同材质的薄膜构成复合多膜层结构，适合大规模光学、电学薄膜的生产，做到一机多用具有高效率、高可靠性、低成本的优势。

本产品可广泛应用于触摸屏ITO镀膜、LCD显示屏ITO镀膜、薄膜太阳能电池背电极及AZO镀膜、彩色滤光片镀膜、电磁屏蔽玻璃镀膜、AR镀膜、装饰镀膜等产业领域。

磁控溅射机公司-磁控溅射机-沈阳鹏程真空技术公司(查看)由沈阳鹏程真空技术有限责任公司提供。沈阳鹏程真空技术有限责任公司（www.pengchengzk.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。沈阳鹏程——您可信赖的朋友，公司地址：沈阳市沈河区凌云街35号，联系人：董顺。